

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 18 年 1 月 26 日 (2006.1.26)

【公開番号】特開 2000-77345 (P2000-77345A)

【公開日】平成 12 年 3 月 14 日 (2000.3.14)

【出願番号】特願 平 10-248635

【国際特許分類】

**H 0 1 L 21/22 (2006.01)**

**H 0 1 L 21/205 (2006.01)**

**H 0 1 L 21/324 (2006.01)**

【F I】

H 0 1 L 21/22 5 1 1 A

H 0 1 L 21/205

H 0 1 L 21/324 K

H 0 1 L 21/324 T

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 12 月 7 日 (2005.12.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】炉を加熱するヒータと、

前記ヒータに供給する電力を制御信号に応じて通電制御する電力制御回路と、

前記電力制御回路に加える制御信号を生成する複数の制御信号生成手段と、

半導体製造プロセスの各ステップに応じて前記複数の制御信号生成手段を選択する切替手段と、

前記炉内外の検出温度をもとに前記ヒータに供給する電力を決定する電力決定手段と、

前記電力決定手段で決定されたヒータ供給電力を得るために要求される制御信号を、前記切替手段によって選択された前記制御信号生成手段に生成される制御手段とを備えた熱処理装置。

【請求項 2】炉内外の検出温度をもとにヒータに供給する電力を決定し、この決定されたヒータ供給電力を得るために、半導体製造プロセスの各ステップに応じて複数の制御信号生成手段を選択し、この選択された前記制御信号生成手段に生成される制御信号を出力し、この出力された制御信号に応じて前記ヒータに与える電力を制御することを特徴とする熱処理装置における温度制御方法。